BEST AVAILABLE COP

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-085836

(43)Date of publication of application : 20.03.2003

(51)Int.CI.

G11B 7/26 G11B 7/24

(21)Application number: 2001-274651

(71)Applicant: TDK CORP

(22)Date of filing:

11.09.2001

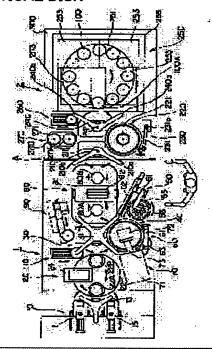
(72)Inventor: KANEKO YUKIO

MIFUNE HIROYOSHI USAMI MAMORU KOMAKI TAKESHI HAYASHIDA NAOKI

(54) METHOD AND APPARATUS FOR MANUFACTURING OPTICAL DISK

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To simplify the constitution of an apparatus which performs manufacturing of an optical disk including a process step of forming ≥2 continuous layers of radiation-curing resins on the disk. SOLUTION: The apparatus for manufacturing has a first coating means for forming the first layer by coating the surface of the optical disk with a first liquid material of a radiation curing type, a second coating means for forming the second layer by coating the surface of the first layer on the optical disk with a second liquid material of a radiation curing type and a single radiation irradiation means for irradiating the disk with radiations having an effect of curing the first and second liquid materials of the radiation curing type after the coating of the first layer by the first coating means and after the coating of the second layer by the second coating means.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

14.02.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3662531

[Date of registration]

01.04.2005

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-85836 (P2003-85836A)

(43)公開日 平成15年3月20日(2003.3.20)

(51) Int.CL'		識別記号	ΡI	テーマコート [*] (参考)
G11B	7/26	531	G11B 7/26	531 5D029
	7/24	535	7/24	535K 5D121

審査請求 未請求 請求項の数16 OL (全 14 頁)

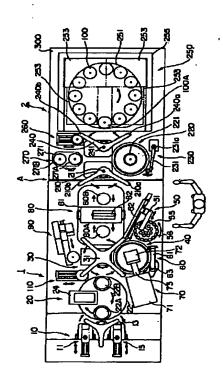
(21)出顧番号	特顧2001-274651(P2001-274651)	(71)出願人	000003067
			ティーディーケイ株式会社
(22)出願日	平成13年9月11日(2001.9.11)		東京都中央区日本橋1丁目13番1号
		(72)発明者	金子 幸生
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(72)発明者	三船 裕喜
			東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ
			ーディーケイ株式会社内
		(74)代理人	
			弁理士 岡部 正夫 (外10名)
	,		最終質に続く

(54) 【発明の名称】 光ディスクの製造方法および装置

(57)【要約】

【課題】 ディスクに連続する2層以上の放射線硬化型 樹脂層を形成する工程を含んだ光ディスク製造を行う装 置の構成を簡略化する。

【解決手段】 製造装置は、光ディスク上に第1の放射線硬化型の液状材料をコーティングして第1の層を形成する第1のコーティング手段と、ディスク上の第1の層の上に第2の放射線硬化型の液状材料をコーティングして第2の層を形成する第2のコーティング手段と、第1のコーティング手段による第1の層のコーティング後および第2のコーティング手段による第2の層のコーティング後にディスクに前記第1および第2の放射線硬化型液状材料を硬化させる作用を持つ放射線を照射する単一の放射線照射手段とを有する。



۱۷.

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光ディスクの製造装置であって、

光ディスク上に第1の放射線硬化型の液状材料をコーティングして第1の層を形成する第1のコーティング手段と

前記ディスク上の第1の層の上に第2の放射線硬化型の 液状材料をコーティングして第2の層を形成する第2の コーティング手段と、

前記第1のコーティング手段による第1の層のコーティング後および前記第2のコーティング手段による第2の層のコーティング後にディスクに前記第1および第2の放射線硬化型液状材料を硬化させる作用を持つ放射線を照射する単一の放射線照射手段と、を有することを特徴とする光ディスクの製造装置。

【請求項2】 前記放射線照射手段は前記第1の層のコーティング後のディスクへの放射線照射時と前記第2の層のコーティング後のディスクへの放射線照射時とで照射条件を変えることを特徴とする請求項1記載の光ディスク製造装置。

【請求項3】 前記放射線照射手段は第1のコーティング手段による前記第1の放射線硬化型液状材料のコーティング後にディスクに放射線を照射して該第1の放射線硬化型液状材料の第1の層を半硬化させ、その後第2のコーティング手段によって前記第2の放射線硬化型液状材料をコーティングして第2の層を形成し、その後、前記放射線照射手段はディスクに放射線を照射して前記第1の層および第2の層を完全に硬化させることを特徴とする請求項1または2記載の光ディスク製造装置。

【請求項4】 前記第2のコーティング手段による前記 第2層のコーティング後であって前記放射線照射手段に よる2回目の照射の前にディスクを加熱する加熱手段を 更に有することを特徴とする請求項1乃至3のいずれか に記載の光ディスク製造装置。

【請求項5】 前記加熱手段は赤外線パネルヒーターを 有することを特徴とする請求項4記載の光ディスク製造 装置。

【請求項6】 前記加熱手段により加熱されたディスクを所定時間載置しディスクを自然冷却するための冷却テーブルを有することを特徴とする請求項4または5記載の光ディスク製造装置。

【請求項7】 前記光ディスクの前記第1の層は、記録 および/または再生光を透過する光透過層、第2の層は 前記光透過層の保護のためのハードコート層であること を特徴とする請求項1乃至6のいずれかに記載の光ディスク製造装置。

【請求項8】 少なくとも2層の放射線硬化型樹脂層を 積層する工程を含む光ディスクの製造方法であって、一 つの樹脂層を積層した後に該樹脂層を硬化させる作用を 持つ放射線を照射し、該樹脂層が半硬化の状態で照射を やめて次の層を積層するという工程を繰り返し、最後の 層を積層した後に放射線を照射して全ての層を完全硬化 させることを特徴とする光ディスク製造方法。

【請求項9】 前記放射線硬化型樹脂層の積層をスピンコートにより行うことを特徴とする請求項8記載の光ディスク製造方法。

【請求項10】 上記放射線は紫外線であることを特徴とする請求項8又は9記載の光ディスク製造方法。

【請求項11】 前記光ディスクの前記少なくとも2層の放射線硬化型樹脂層は、記録および/または再生光を透過する光透過層とその上に積層される光透過層の保護のためのハードコート層を含むことを特徴とする請求項8乃至10のいずれかに記載の光ディスク製造方法。

【請求項12】 ディスク体を保持して回転するスピンナー機構と、前記スピンナー機構に保持された前記ディスク体の中央付近に液状材料を供給するディスペンサー機構とを有し、ディスク体を前記スピンナー機構により回転させながらディスク体中央付近に液状材料を供給することで遠心力により該液状材料をディスク体上に展延し、ディスク体表面に前記液状材料の塗膜を形成するスピンコーティング装置において、前記ディスペンサー機構は一体的に設けられたディスク表面をクリーニングするためのクリーナを有していることを特徴とするスピンコーティング装置。

【請求項13】 ディスク体にスピンコーティングを施すコートスピンナー部と、

コートスピンナーにより塗膜を形成されたディスクを加 熱する乾燥部と、

乾燥部から取り出されたディスクを自然冷却するための 冷却テーブル部と、

所定の搬入位置に置かれているディスクを前記コートスピンナー部に移載し、同時に冷却テーブル部上に置かれているディスクを所定の搬出位置に移載する第1のディスク移載ハンドと、

前記コートスピンナー部に置かれているディスクを前記 乾燥部に移載し、同時に前記乾燥部に置かれているディ スクを前記冷却テーブル部に移載する第2のディスク移 載ハンドと、を有するスピンコーティング装置であっ て、

前記冷却テーブル部はディスクを載置した部分を一方向 に前後に移動させる前後移動機構を有し、該前後移動に より前記第1の移載ハンドによって冷却テーブル上のデ ィスクをピックアップする位置と前記第2の移載ハンド によって冷却テーブル上にディスクを置く位置との位置 ずれを補償することを特徴とするスピンコーティング装 置。

【請求項14】 請求項13に記載のスピンコーティング装置で、前記冷却テーブル部は装置ベースプレートに対するその取り付け方向が調節可能であり、それにより前記前後移動の方向を調節可能であることを特徴とする請求項13記載のスピンコーティング装置。

【請求項15】 物品に連続的に処理を施すための第 1、第2、第3の処理装置と、

所定の搬入位置に置かれている物品をピックアップして前記第1の処理装置に移載し、同時に第3の処理装置に 置かれている物品をピックアップして所定の搬出位置に 移載する第1の物品移載ハンドと、

前記第1の処理装置に置かれている物品をピックアップして前記第2の処理装置に移載し、同時に第2の処理装置に登載して前記第2の処理装置に置かれている物品をピックアップして第3の処理装置に移載する第2の物品移載ハンドと、を有し、

前記第1および第3の処理装置のいずれか一方は、少なくとも前記物品を載置した部分を一方向に前後移動させる移動機構を有し、該前後移動により上記第1の物品移載ハンドと第2の物品移載ハンドとの位置ずれを補償することを特徴とする物品処理システム。

【請求項16】 第1および第3の処理装置の前記一方はその取り付け方向が調節可能であり、それにより前記前後移動の方向を調節可能であることを特徴とする請求項15記載の物品処理システム。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はディスク体上に、スピンコーティングなどのコーティングにより放射線硬化型の材料を塗膜して光ディスクを製造する方法および装置に関わるものである。本発明の方法および装置は例えばCD、CD-R、CD-RWなどのCD系ディスクやDVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMなどのDVD系ディスク、あるいは近年開発が進んでいるブルーレーザー対応ディスクなどの光ディスクあるいはMO、MDなどの光磁気ディスクの作成に適し30ている。

[0002]

【従来の技術】スピンコーティングはディスク体の中心付近に液状材料を供給し、ディスク体を回転させて回転による遠心力で該液状材料を展延し、ディスク体表面に該液状材料の被膜を均一な厚さで形成するという技術である。スピンコーティングは例えばCD系ディスクおよびDVD系ディスクなどの保護層の形成等に広く利用されている。

【0003】他方で近年、次世代の情報記録媒体としてプルーレーザー対応ディスクの開発が進んでいる。従来のコンパクトディスクやDVDディスクはポリカーボネートなどの透明基板を有し、その透明基板側から透明基板を通して情報の再生を(記録型ディスクの場合には記録も)行うが、このブルーレーザー対応ディスクは基板とは反対側から情報の記録再生を行う。そのために記録層(あるいは反射層)の上に厚さ0.1mm(100 μm)の透明な光透過層を形成する必要がある。

【0004】本願出願人は先に出願された特願2001-121 377号において、このようなブルーレーザー対応ディス クの光透過層の形成に好適に適用できるスピンコーティング方法を提案しており、これにより膜厚の精密な制御を要求されるブルーレーザー対応ディスクの光透過層を放射線硬化型材料で形成することを可能としたが、ブルーレーザー対応ディスクではその光透過層の上に更に表面保護のための保護コート層(ハードコート層)を形成する必要がある。この保護コート層も放射線硬化型材料をスピンコーティングなどによりコーティングして形成するのが好適である。

10 [0005]

【発明が解決しようとする課題】上に例として述べたブルーレーザー対応ディスクのように、CD/DVD系の光記録媒体ディスクでは通常、紫外線硬化型樹脂などの放射線硬化型材料をコーティングすることにより、保護コート層を形成している。その際例えば上述のブルーレーザー対応ディスクにおける光透過層と保護コート層、あるいはトップコート層とその上に形成される保護コートなどの機能層のように、記録媒体ディスクにおいて2つの連続する層を共に放射線硬化型材料を用いたコーティングにより積層することが求められる場合がある。このような場合従来は一つの装置で1層目を積層していた。従って紫外線照射器が2台必要であり、また1層目と2層目の界面が形成されることにより、1層目と2層目の材料によってはクラックが発生するという問題があった。

[0006]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため、本発明による光ディスクの製造装置は、光ディスクル上に第1の放射線硬化型の液状材料をスピンコーティングして第1の層を形成する第1のスピンコーティング手段と、ディスク上の上記第1の層の上に第2の放射線硬化型の液状材料をスピンコーティングして第2の層を形成する第2のスピンコーティング手段と、第1のスピンコーティング手段による第1の層のコーティング後にディスクに第1および第2の放射線硬化型液状材料を硬化させる作用を持つ放射線を照射する単一の放射線照射手段と、を有することを特徴とする。

【0007】このようにディスクに2層の放射線硬化型 液状材料をコーティングするに際して単一の放射線照射 手段を共通に用いて液状材料の硬化を行うことで装置構 成を簡略化することができる。

【0008】この装置において、好適には放射線照射手段は第1の層のコーティング後のディスクへの放射線照射時と第2の層のコーティング後のディスクへの放射線照射時とで照射放射線強度、照射時間、積算線量などの照射条件を変えることができる。

【0009】またこの装置において、放射線照射手段は 第1のスピンコーティング手段による第1の放射線硬化 50 型液状材料のコーティング後にディスクに放射線を照射

30

5

して該第1の放射線硬化型液状材料の第1の層を半硬化させ、その後第2のスピンコーティング手段によって第2の放射線硬化型液状材料をコーティングして第2の層を形成し、その後、放射線照射手段はディスクに放射線を照射して第1の層および第2の層を完全に硬化させることもできる。この場合第1の層を完全に硬化させてから第2層をコーティングする場合に比べて処理時間を短縮することができる。また半硬化状態で次の層をコーティングし、その後に両層を完全に硬化させることにより両層の接着性が増し、材料の膨張・収縮による両層間のクラックの発生が低減される。

【0010】またこの装置において、第2のスピンコーティング手段による第2層のコーティング後であって放射線照射手段による2回目の照射の前にディスクを加熱する加熱手段を設け、ディスクのアニールおよび乾燥を行うようにしてもよい。この加熱手段は赤外線パネルヒーターとすると熱がディスクに直接吸収されるので温度の立ち上がりが早く、また装置の他の部分があまり熱せられないので好適である。

【0011】また好適には加熱手段により加熱されたディスクを所定時間載置しディスクを自然冷却するための冷却テーブルを設ける。

【0012】この装置はブルーレーザー対応ディスクの 製造に好適に用いることができ、その場合上記第1の層 はその光透過層、第2の層はハードコート層に相当す ス

【0013】また本発明の提供する光ディスク製造方法は、少なくとも2層の放射線硬化型樹脂層を積層する工程を含む光ディスクの製造方法であって、一つの樹脂層を積層した後に該樹脂層を硬化させる作用を持つ放射線を照射し、該樹脂層が半硬化の状態で照射をやめて次の層を積層するという工程を繰り返し、最後の層を積層した後に放射線を照射して全ての層を完全硬化させることを特徴とする。

【0014】このように各層を完全に硬化させずに半硬化状態で次の層を積層することで処理時間を短縮することができる。また層間の界面形成によるクラックの発生が低減される。

【0015】本発明の方法をブルーレーザー対応ディスクの製造に適用し、上記少なくとも2層の放射線硬化型樹脂層としての光透過層およびその上に積層されるハードコート層の形成に好適に用いることができる。

【0016】なお上述の本発明による光ディスク製造装置および光ディスク製造方法において放射線硬化型の液状材料に言及しているが、本明細書において放射線硬化型液状材料とは広く光(可視光、紫外線、赤外線を含む)、電磁波(波長を問わず)、X線、電子線さらには超音波等の振動波のも含めたものとしての放射線により硬化する液状材料を意味するものとする。該液状材料を硬化させるために放射される放射線ももちろんそれに応 50

じたものとなる。

【0017】また光ディスクはCD、CD-R、CD-RWなどのコンパクトディスクやDVD-ROM、DVD-R、DVD-RW、DVD-RAMなどのDVD系ディスク、あるいは近年開発が進んでいるブルーレーザー対応ディスクなどの光ディスクあるいはMO、MDなどの光磁気ディスク等を含む。

6

【0018】本発明のまた別の態様は上記のような光ディスク製造装置に好適に適用することのできる物品処理システムに関わる。

【0019】該物品処理システムは、物品に連続的に処理を施すための第1、第2、第3の処理装置と、所定の搬入位置に置かれている物品をピックアップして第1の処理装置に移載し、同時に第3の処理装置に置かれている物品をピックアップして所定の搬出位置に移載する第1の物品移載ハンドと、第1の処理装置に移載し、同時に第2の処理装置に置かれている物品をピックアップして第2の処理装置に移載する第2の物品移載ハンドと、を有し、第1および第3の処理装置のいずれか一方は、少なくとも物品を載置した部分を一方向に前後移動させる移動機構を有し、該前後移動により上記第1の物品移載ハンドと第2の物品移載ハンドとの位置ずれを補償することを特徴とする。

【0020】それぞれ物品を2箇所から同時に移載する移載ハンドを2つ用いたシステムでは2つの移載ハンドの動作位置を正確に合わせることが困難であるが、本発明のように一つの処理装置上の物品の位置を一方向に前後移動可能とすることにより、この位置ずれを補償して、移載ハンドによる物品のピックアップを正確に行うことができる。

【0021】このシステムにおいて更に、第1および第3の処理装置の前記一方の取り付け方向を調節可能とし、それにより前記前後移動の方向を調節可能とすれば、2つの物品移載ハンドの間の位置ずれ方向に上記前後移動の方向を一致させることができるので、位置ずれの補償をより好適に行うことができる。

[0022]

【発明の実施の形態】以下において図面を参照して本発明の好適な実施形態を説明する。図1は本発明の実施形態としての光ディスクのコーティング装置の平面図である。このコーティング装置は次世代ディスクであるブルーレーザー対応ディスクの光透過層およびハードコート層の形成に好適に用いられる装置である。

【0023】再生専用のブルーレーザー対応ディスクは情報ピットを形成した直径120mm、厚さ1.1mmのポリカーボネート基板に、アルミニウムの反射膜をスパッタ法によって形成し、その表面に放射線硬化型材料としての光(UV即ち紫外線)硬化型樹脂をスピンコートして厚さ100μmの光透過層を形成し、更にその上にUV硬化型の

アクリル樹脂層をスピンコーティングにより積層して厚 さ2 μmのハードコート層(保護コート層)を形成する ことによって作成される。本実施例の装置はこの光透過 層および保護コート層のスピンコーティングを行う装置

【0024】コーティング装置は図1のラインAを境に 左側に位置するスピンコート部1と、右側に位置するハ ードコート部2とからなる。スピンコート部1はブルー レーザー対応ディスクの光透過層をスピンコーティング により形成するものであり、他方ハードコート部はその 10 光透過層の上に更にハードコート層をスピンコーティン グによって形成するものである。なお本実施例のコーテ ィング装置では、図1でAと表示された部分でスピンコ ート部1とハードコート部2とに分かれているが、これ らを連続する一体的な装置として構成することも可能で ある。

【0025】スピンコート部1は以下の諸部分を備えて いる、即ち、外部からコーティングを行うべきディスク を供給し、またコーティング処理の終わったディスクを 装置から外部に取り出すためのロード・アンロード部1 0と、ロード・アンロード部から供給されたディスクの 表面の塵埃などの異物を除去するためのクリーナー部2 0と、装置内の各部間でディスクの同期移動を行う移載 ハンド部30と、樹脂層のスピンコートを行うためにデ ィスクを回転させるスピンナー部40と、スピンコーテ ィング時にスピンナー部に載置されたディスクの中央部 をカバーするマスクを供給しまた取り外すマスク供給排 出部50と、コーティング時にディスク外周部エッジか らはみ出した余分の樹脂材料を除去するエッジクリーニ ング部60と、スピンコート時にスピンナー上のディス 30 クに塗布された樹脂層の表面を紫外線により仮硬化させ る仮硬化UV放射部70と、ディスクに塗布された樹脂 層を本硬化させる本硬化UV放射部80と、ディスクに 形成された樹脂層の膜厚を検査する膜厚検査部90と、 樹脂層の形成が不良であるディスクを排出する不良品排 出部110と、である。

【0026】まず処理の流れに沿って、スピンコート部 1の上記各部の動作を順に説明する。ロード・アンロー ド部10のローダー部11はコーティングを施すべきデ ィスクをスタックされた(積み重ねられた)状態で複数 40 保持するピンホルダー111を有している。 ディスクは その中心穴にピンホルダー111のピン111aが挿入 されて保持される。ピンホルダーに保持されたディスク どうしの間にはスペーサを挿入してディスクを互いに離 間させる。スタックされたディスクの下にはディスクス タックを昇降させるリフター112が設けられている。 このリフター112によりスタックの一番上のディスク が所定の供給高さ位置となるようにレベル調整する。

【0027】ロード・アンロード部はまた供給ハンド1

120度間隔で)放射状に延びる3つのアームを有して いる。アームの先端部下側にはディスクを吸着する真空 吸着などにより吸着・解放するディスクピックアップ機 構が設けられている。供給ハンド13は装置制御部(不 図示) による所定の制御の下にその軸13d周りに揺動 するよう構成されている。供給ハンド3の一つのアーム 13aによりローダー11のピンホルダー111内の一 番上のディスクをピックアップしてクリーナー部のター ンテーブル22上の供給・排出位置22Aに移載する。 このとき同時に別のアーム13bによりターンテーブル 22上の位置22Aからアンローダー部のピンホルダー 115上へ処理済みのディスクを移載することができ る。もう一つのアーム13cはローダー部のピンホルダ **ー111にスタックされたディスク間に挿入されている** スペーサをアンローダー部のピンホルダー115上に移 載するためのものである。

【0028】以上のような供給ハンドの動作の詳細は同 一出願人による特願平11-289267に詳細に説明 されている。

【0029】クリーナ部20のターンテーブル22に移 載されたディスクはターンテーブルの時計回りの回転に よりターンテーブルに載ったままクリーナー24内に入 る。クリーナー24はディスク表面にクリーンエアを吹 きかけるプロアとプロアの風により吹き飛ばされた塵埃 等のパーティクルを吸い込む真空吸引器とを備えてい る。好適にはターンテーブル22の回転速度を変速制御 し、ディスクがクリーナー24内を移動している間は回 転速度を遅くして、十分な時間をかけてディスククリー ニングを行うようにするとよい。またクリーニング時間 を更に延長するために、ディスクがクリーナー24内に 入った時点でターンテーブル22の回転を一旦止め、デ ィスクを所定時間の間クリーナー24内に停留させた後 に回転を再開するようにする事もできる。

【0030】なお、本実施形態では、ディスクのクリー ニングを十分行うために、ディスクを運搬するターンテ ープル22を変速制御してディスクがクリーナー24内 に滞在する時間を延長しているが、必要がなければター ンテーブルを定速で回転させるようにしてもよい。

【0031】ディスクがクリーナー24を通過してディ スクがターンテーブル22上で受け渡し位置22B(即 ち供給・排出位置22Aから180度回転した位置)に 達するとディスクは移載ハンド部30の移載ハンド31 によりスピンナー部に移載される。

【0032】移載ハンド31は先に説明した供給ハンド 30と類似の構造であるが、供給ハンド30が3つのア ームを持つのに対し、移載ハンド31は等間隔で(即ち 90度間隔で)放射状に延びる4つのアーム31a.3 1 b, 31 c, 31 dを有している。アームの先端部下 側にはディスクを吸着する真空吸着などにより吸着・解 3を備えている。この供給13ハンドは等間隔で(即ち 50 放するディスクピックアップ機構が設けられている。供

20

30

40

給ハンド13は装置制御部による所定の制御の下にその 軸13a周りに揺動するよう構成されている。

【0033】なお、移載ハンド31はその4本のアーム 31a~31dにより装置の各部間でのディスクの移動 を同時に行う。図1に示された状態は移載ハンド31の 待機位置を示している。この状態から時計回りに 4 5 度 回転することにより、アーム31a, 13b, 31c, 31 dはそれぞれクリーナ部、スピンナー部、本硬化U V放射部、膜厚検査部に位置するディスクをピックアッ プできる位置となる。その位置で各アームはそれぞれデ ィスクを真空吸着によりピックアップする。その後、移 載ハンド31は反時計回りに90度回転する。これによ りクリーナ部にあったディスクはスピンナー部に、スピ ンナー部にあったディスクは本硬化UV放射部に、本硬 化UV放射部にあったディスクは膜厚検査部に、膜厚検 査部にあったディスクはクリーナ部に、それぞれ同時に 移動し、それぞれの位置で各アームはディスクを解放す る。このようにして移載ハンド31による各部間のディ スクの同時移動が行われる。

【0034】クリーナ部20からスピンナー部40に移載されたディスクは高速回転されるスピンナーテーブル(不図示)上に設置され、真空吸着される。ディスクはこのスピンナーテーブル上で光透過層のスピンコーティングを施される。周知のようにブルーレーザー対応ディスクに限らず一般的に光ディスクでは、ディスクの中心にはディスクドライブ装置への装着の際の芯出しのための穴(15φ)が形成されており、また射出成形時のスタンパの保持のための溝などがあるため、ディスク基板の中心部には塗膜を形成しない。従って本装置によるスピンコーティングに際しても、ディスク中心領域における光透過性樹脂膜の形成を防止するために、該領域を覆うマスク部材としてのセンターマスクを取り付ける。

【0035】スピンナー部40内のスピンナーテーブル上のディスク100へのセンターマスク56の供給および取り外しはマスク供給排出部50により行われる。マスク供給排出部50は円盤状でその中心周りに回転可能なマスクストレージ55、マスクストレージ上に2重の円周配列をなして置かれている複数のマスク56(図1の例では合計24個のマスクが示されている)、マスクを把持するマスクチャックを有するマスク移動アーム51、マスク移動アーム51をマスクストレージ55とスピンナー40との間で往復移動させるボールねじ52などを含む。マスク移動アームにはディスク上にコーティング材料(光透過膜を形成する光硬化型樹脂)を供給するディスペンサーが一体的に取り付けられている。

【0036】マスク移動アーム51のマスクチャックによりマスクストレージ55上のマスクをピックアップし、スピンナー40に設置されたディスク上にマスクを取り付ける。その後マスク移動アーム51の先端部に設けられたディスペンサーからマスク上に液状の光硬化型

10

樹脂を供給し、その後マスク移動アーム51をスピンナー40から退避させる。

【0037】マスク移動アーム51が退避した後に(前あるいはその途中でもよい)スピンナーテーブル152 を高速で回転させ、スピンコーティング動作を行う、即ち中心部に供給された光硬化型樹脂を回転の遠心力によりディスクの上面全面に分布するようにさせる。

【0038】スピンナーテーブルの回転によるスピンコーティング開始後所定の時間が経過してディスク上にほぼ均一な膜厚の樹脂層が形成されると、エッジクリーニング部60のエッジクリーナ61により、ディスクの外周部にはみ出した樹脂をはぎ取るエッジクリーニングを行う。エッジクリーナ61は軸63周りに装置水平面内で揺動可能であり、揺動によりエッジクリーナ61の一端に取り付けられたナイフエッジ65がディスクの外周端面に接近し、ディスク外周からはみ出した光硬化型樹脂をそぎ取る。

【0039】このようなディスクエッジクリーニング後に、仮硬化UV放射部70による光硬化型樹脂の仮硬化を行う。スピンコーティングによりディスク面に均等に膜形成された樹脂膜は、スピンを止めると液状樹脂の表面張力によりその膜厚の均一性を失い、特に外周部が盛り上がった不均一性を生ずる。また樹脂の粘度が高いほど膜厚の不均一性が大きくなる。これを防止するため、スピンコーティング後にスピンナーの回転を止めずに、仮硬化UV放射部70によりUV光を照射し、樹脂層の仮硬化を行う。

【0040】仮硬化UV放射部70は本体部71、照射へッド部72、および本体部と照射へッド部とを連結する連結筒部73を含んでいる。本体部71内にはUV光源としての超高圧水銀ランプ(不図示)が設置されている。超高圧水銀ランプはUV硬化型樹脂を硬化しうる紫外線(UV)領域を含む波長の光(以下UV光と称する)を発する。本体部71内には更に、集光・送出光学系(不図示)が設置されており、超高圧水銀ランプからのUV光を集光し、連結筒部73に向かうUV光ピームとして送出する。連結筒部73に向かうUV光ピームとして送出する。連結筒部73は中空の筒体であり、UV光ピームは該連結筒部内を通過して照射へッド部72に入射する。照射へッド部72は反射板を内蔵しており、連結筒部73より入射したUV光ピームを90度折り曲げて下方のディスクに向けて照射する。

【0041】照射ヘッド部72による照明領域の外径はディスク外径とほぼ一致するようになされており、また内径はマスク外径とほぼ一致するようになされている。これによりUV光ビームの照射領域はマスク部より外側のディスク全体とほぼ一致する。即ち仮硬化UV部によるUV光はディスク上に置かれたマスクには照射されない。スピンコーティング時にはマスク上に液状の光硬化型樹脂が滴下されるので、マスクにUV光を照射してしまうとマスクおよびマスクとディスクの境界部の樹脂が

硬化され、マスクの除去が困難となる。これを防止する ためにマスク部にUV光が当たらないようになされてい るわけである。

【0042】この仮硬化UV放射部によるUV照射は、ディスク上にコーティングされた光硬化型樹脂層がその表面張力により膜厚の不均一を発生することを防止するためのものであるので、単に樹脂層の表面張力による膜厚の不均一が発生しない程度に材料の流動性を低下させるものであればよい。そのための照射強度および照射時間はディスク上にコーティングされた樹脂の種類や膜厚に応じて適宜決められる。

【0043】仮硬化用のUVを照射した後、スピンナーの回転を止める。続いてマスク56の真空吸着を解除し、マスク移動アーム51によりマスクをディスク上からピックアップしてマスクストレージ55に移載する。【0044】更にスピンナーテーブル上のディスクの真空吸着を解除し、移載ハンド部30のアーム31bによりディスクをピックアップして本硬化UV放射部80上の位置80Aに移動する。

【0045】本硬化UV放射部80はUV光を照射するUV照射ユニット81とディスク100を回転させながら直線移動させるディスク移動機構85とを有する。UV照射ユニットはUVランプ82を有し、下方にUV光を照射する装置である。図2は本硬化UV放射部の概要を示す側面図である。本硬化UV照射部80はディスク移動機構85によりディスクを位置80Aから位置80Bに移動させる間にディスクにUV光を照射してディスク上のUV硬化型樹脂の硬化を更に進めるものである。

【0046】図3は本硬化UV放射部80のディスク移 動機構85の要部を示す図であり、図2とは90度異な る方向からの側面図である。図2、図3を参照して本硬 化UV放射部の構成を説明する。ディスク移動ユニット はディスクを保持するスピンドルユニット182と該ス ピンドルユニットを直線移動させるためのサーボモータ 駆動ボールねじユニット180とを含んでいる。図3か らわかるように、スピンドルユニット182のハウジン グ186はプレート187を介してボールねじユニット 180の被駆動ナットに固定されている。ハウジング1 86内には不図示のペアリングにより回転可能に支持さ れたスピンドル183が設置されている。スピンドル1 83はカプリング185を介してサーボモータ184に 連結されており、該サーボモータ184により回転駆動 される。スピンドル183の頂部はディスク100の中 央の穴にはまり込むようになされており、さらにディス ク100を真空吸着するための機構も設けられている。

【0047】以上に説明した機構により、本硬化UV放射部80のスピンドル183上に設置されたディスク100はサーボモータ184により回転されながらボールねじユニットにより直線移動することができる。

【0048】本硬化UV放射部80は、ディスク上にコ 50 を一時仮置きする第3の処理装置としての冷却仮置きテ

ーティングされた光硬化型樹脂層の硬化に際して、ディスク100を回転させながらUV照射ユニットの照射領域を通過するように制御する。照射時にディスクが回転

していることにより、UV照射ユニットの照射光分布に 不均一性があっても、ディスクの各部が受けるUV照射 量を均一化することができる。

12

【0049】上記仮硬化UV放射部70によるUV照射により流動性が低下する程度に硬化された光透過層を構成する光硬化型樹脂は、本硬化UV放射部80の位置80Aから位置80Bに向かうこの往路において更に硬化される。しかしながらこの時点では必ずしも光透過層を完全に硬化させる必要はなく、半硬化状態にとどめておいてよい。ここで半硬化とは放射線(本実施形態では紫外線)の照射により樹脂の硬化が生じてはいるが、更なる照射による硬化の余地を残している状態を言う。この光透過層を構成する光硬化型樹脂の完全な硬化は、後述するハードコート層の塗膜後に、本硬化UV放射部の復路において、ハードコート層の硬化と共に行う。

【0050】上記往路におけるボールねじユニットによるディスクの直線移動制御は、この時点で必要な光硬化型樹脂の硬化の程度、それに必要なUV照射線量などの諸条件に応じて適宜決められる。たとえば一定速度でUV照射ユニットの照射領域を往復させてもよいし、または照射領域内で一旦停止、あるいは速度を低下させて、照射時間を延長するようにしてもよい。

【0051】以上に説明したようにディスク100は位置80Aから位置80Bに移動される過程でUV照射を受ける。位置80Bはハードコート部2への移載位置である。即ち位置80Bにおいてディスクはスピンコート部1からハードコート部2へと移載される。

【0052】ここでハードコート部2の構成の概要を説 明する。ハードコート部2はスピンコート部1とハード コート部2との間でディスクの受け渡しを行う第1の移 載ハンドであるコートハンド210と、スピンコート部 によりコーティングされた光透過層の上にハードコート 層をスピンコーティングするための第1の処理装置とし てのコートスピンナー部220と、コートスピンナー部 220に設置されたディスクにハードコート用のUV硬 化型樹脂を供給するディスペンサー部230であってデ ィスク表面をクリーニングするクリーナを兼ねるディス ペンサー部230と、乾燥テーブル(後述)の前後での ディスクの移動を行う第2の移載ハンドとしての乾燥ハ ンド240、コートスピンナーでハードコート層をコー ティングされたディスクの乾燥およびアニールを行う第 2の処理装置としての乾燥部250と、不具合により装 置の運転が停止した際に乾燥部250でディスクが過度 に熱せされてしまうのを防止するためにディスクをスト ックしておくディスクストック部260と、乾燥部25 0から取り出されたディスクを冷却するためにディスク

40

20

13

ーブル部270と、を含んでいる。

【0053】続いて以上に述べたハードコート部2の各部の動作について順を追って説明する。

【0054】スピンコート部1の本硬化UV放射部80 の位置80 Bにあるディスクはコートハンド210によ りピックアップされてコートスピンナー部220のスピ ンナーテーブル221上に設置される。コートハンド2 10はその軸211周りに枢動可能であり、図1に示し た状態から時計回りに45度枢動することにより、一方 のアーム210aが位置80Bのディスク上に位置す る。この位置においてアーム210aの先端部に設けた 真空吸着機構(不図示)により位置80Bにあるディス クをピックアップする。その後コートハンド210を反 時計回りに90度枢動させディスクをコートスピンナー 220上に運び、その位置でディスクの真空吸着を解放 してディスクをスピンナーテーブル221上に設置す る。なお、アーム210aによりディスクを本硬化UV 放射部の位置80Bからコートスピンナー220に移動 するとき、同時にコートハンド210の他方のアーム2 10 bが冷却仮置きテーブル部270上のディスクを位 置80Bに移動する。

【0055】コートスピンナー上でディスク上にハード コート層をスピンコーティングするわけであるが、スピ ンコーティングに先立ってディスペンサー部によるディ スク表面のクリーニングを行う。図4にディスペンサー 部の側面図を示す。ディスペンサー部は軸231a(図 1) 周りに枢動可能なディスクスペンサーアーム231 を有している。該ディスペンサーアーム231にハード コート液塗布ノズル233と除電クリーナーノズル23 5とが取り付けられている。除電クリーナーノズルはイ オンを発生する除電装置237に連結されており、イオ ンを含んだエアをディスク表面に吹き付けることによ り、除電しながらディスク表面の塵埃を吹き飛ばしてク リーニングを行う。クリーニングを行う際にはスピンナ ーテーブル221によりディスク100を回転させなが らディスペンサーアーム231を軸231a周りに揺動 させることでディスク上を径方向に数回往復させる。

【0056】ディスク100のクリーニングが終了した後、ディスペンサーのハードコート液塗布ノズル233 によりディスクにハードコート層用の液状UV硬化型樹脂を滴下し、ディスクを高速回転させてハードコート層のスピンコーティングを行う。なお本実施形態ではハードコート層としてUV硬化型樹脂を用いているが、ハードコート層はこれに限らず、スピンコート部で使用されたエネルギー線で硬化する材料であればその他のものであってもよい。例えばEB硬化型樹脂などのその他のエネルギー線硬化型樹脂を用いる場合もある。より具体的にはアクリル系樹脂、エポキシ系樹脂、ウレタン樹脂などがあり得る。

【0057】スピンコーティングの終了後、コートスピ 50 テンレス製)の温度は40度C程である。

14

ンナー220内のディスク100を乾燥部250に移送する。図5に乾燥部250の側面図を示す。乾燥部250は円形の乾燥テーブル251と、その上方に設置された4枚の赤外線フラットパネルヒーター253(図1では2点鎖線で示す)を有するヒーターユニット254を備える。乾燥テーブル250はその外周付近に30度間隔で12枚のディスク100を載置できるように構成されている(図1)。乾燥テーブル251はその中心周りに回動可能であり、30度ずつ回転するようにインデックス駆動される。乾燥テーブル251の下部にはインデックス駆動のためのモータ256、インデックス装置(カムユニット)257、および30度回転を検出する1サイクル検出センサ258が設けられている。乾燥テーブル251およびヒーターユニットは乾燥炉255内に設置されている。

【0058】コートスピンナー220からピックアップされたディスク100は乾燥ハンド240のアーム240aにより図1において100Aと表示された乾燥テーブル251上の位置に置かれ、その後乾燥テーブル251の回転につれて一回転して再び100Aと表示された位置に戻ったところで、乾燥ハンドの他方のアーム240bによりピックアップされて次工程へ送られる。乾燥テーブル251が1回転する間にディスク100は上方に設置されたヒーターユニットにより加熱される。この加熱によりディスク上に塗布されたハードコート液の溶剤を蒸発させる乾燥作用と樹脂層の歪みを緩和するアニールとが行われる。アニールすることにより、ディスクの反りが低減される。

【0059】ここではヒーターユニット254に赤外線パネルヒーター253を用いている。これは温風送風式の乾燥システムのように気流によるゴミの付着や、また風圧による膜厚分布の偏りといった問題が生じないので好適である。また雰囲気加熱ではなく熱が直接吸収されるので温度上昇の立ち上がりが早く、またディスク以外の部分(乾燥テーブルなど)の温度があまり上昇しないという利点もある。なお乾燥部内でのディスクの温度はたとえば80~90度程度となるように制御し、各ディスクが乾燥部内にある時間(即ち乾燥テーブル251が1回転する時間)は3~10分程度である。これらの乾燥温度および乾燥時間はディスク基板の材質やディスクに形成された光透過層およびハードコート層の材料および膜厚等に応じて適宜決められる。

【0060】図6に回転テーブル上へのディスクの載置の仕方を示している。ディスク100は回転テーブルに取り付けられたガイドピン252の上に載せられており、回転テーブル251とディスク100とは直接接していない。このような構成と上に説明した赤外線パネルヒーター253の使用により、ディスクは90度C程度まで加熱され、それに対して回転テーブル(ここではステンレス製)の温度は40度C程である。

スクは冷却テーブル上で装置運行の2ステップ分の期間 の間、冷却テーブル271上で冷却される。なお本実施 形態における冷却は自然冷却であるが、種々の形態の強 制冷却を用いてもよい。

16

【0061】乾燥部250の乾燥テーブル251上で1 周してディスク取り出し位置に戻ったディスク100A は、先に述べたように乾燥ハンド240のアーム240 bによりピックアップされて乾燥炉255内から取り出 される。その際の乾燥ハンド240の動きはコートハン ド210の動作と同様である。即ち乾燥ハンド240は まず図1に示した状態から軸241を中心として時計回 りに45度枢動し、そこでアーム240aがコートスピ ンナーのスピンナーテーブル上のディスクをピックアッ プし、同時にアーム240bが乾燥テーブル上のディス ク100Aをピックアップする。そして乾燥ハンド24 0が反時計回りに90度回転することによりコートスピ ンナーのディスクが乾燥テーブルに、乾燥テーブルのデ ィスクが冷却仮置きテーブル部にそれぞれ移送される。 【0062】その際コーティング装置全体の中のどこか の部位で不具合が生じて装置の動作が停止する警告状態 となっている場合には乾燥部250と冷却仮置きテーブ ル部の途中に設置されている加熱ディスクストック部2 60で乾燥ハンドのアーム240bがディスクをリリー スし、ディスクを加熱ディスクストック部260にスト ックする。コーティング装置の運転がトラブルにより停 止した場合、乾燥部からのディスクの取り出しも停止し てしまうと乾燥部内のディスクが適正範囲を超えて長時 間熱にさらされてしまい、ディスク基板のそり等の不良 を生じてしまう。加熱ディスクストック部260はこれ を防止するために設けられているものであり、この実施 形態の装置では装置の他の部位が停止した場合でも乾燥

【0064】冷却仮置きテーブル部270はまた、2つ の移送ハンド即ちコートハンド210と乾燥ハンド24 0との間の位置ずれを補正(吸収)するために装置水平 面内の一方向に前後移動(即ち往復運動)するための前 後シリンダ274(図8)を備えている。冷却仮置きテ ーブル部270は更に、この前後移動の方向を調節する ための機構を有している。即ち、冷却テーブル、ロータ リアクチュエータおよび前後シリンダ274は固定プレ ート275の上に固定されており、この固定プレート2 75の装置のベースプレートに対する取り付け角度位置 が調整可能になされている。以下これを図9を参照して 説明する。

ことができる。 【0063】冷却仮置きテーブル部270は乾燥部25 0で80~90度Cに加熱されたディスクをある程度冷 却するために設けられている。一例としては50度C稈 度まで冷却する。これはこの後ディスクにハードコート 層硬化のためにUV照射を行う際に更にディスク温度が 上がりディスク基板に変形が生ずるのを防止するためで ある。冷却仮置きテーブル部270は2枚のディスクを 載置可能な冷却テーブル271を有している。図7およ び図8は冷却仮置きテーブル部を示す平面図および側面 図である。冷却テーブル271はロータリーアクチュエ ータ273 (図8) により180度旋回可能なテーブル 40 であり、図7に示すように2枚のディスク100を載置 可能である。乾燥ハンド240により乾燥部250から 移送されたディスクはまず冷却テーブル上の位置271 A (図1) に置かれる。その後冷却テーブル271は1 80度旋回し、ディスクは位置271Bに移動する。そ こで次のディスクが位置271Aに置かれ、再び冷却テ ーブルが180度旋回するとはじめのディスクが位置2 71 Aに戻る。ここでこのディスクはコートハンド21 0のアーム210bによりピックアップされて次工程へ

部内のディスクをそれぞれ所定の加熱時間後に取り出す

【0065】図9は冷却仮置きテーブル部270の固定 プレート275および前後シリンダ274の上面図であ る。固定プレート275には一対の円弧状の長孔275 aが設けられている。固定プレート275はこの長孔2 75aに挿通された固定ボルト276により装置の (ハ ードコート部2の)ベースプレート300に固定され る。固定プレート275は長孔内のボルトによりベース プレート300に固定することで固定プレート275の ベースプレート300に対する取り付け角度はある範囲 で調節できる。さらに装置のベースプレート300には 固定ボルト276を固定するためのねじ孔277が45 度間隔で8個設けられている。図9は8個のねじ孔のう ちの2つに固定ボルト276が固定されている状態を示 している。一対の固定ボルト276は8個のねじ孔27 7のうちの対向する任意の2つのねじ孔に固定すること ができるので、上記長孔の存在と相俟って、固定プレー ト275はベースプレート300に対して360度任意 の角度位置に固定することができる。

【0066】このような機構により冷却仮置きテーブル 部はコートハンド210と乾燥ハンド240との間の位 置ずれを補正できる。以下においてこれを説明する。

【0067】既に説明したように、冷却テーブル271 へのディスクの受け渡しは乾燥ハンド240のアーム2 40 bにより行われ、冷却テーブル271からのディス クの取り出しはコートハンド210のアーム210bに より行われる。ところがコートハンド210の位置は本 硬化UV放射部80内の位置80Aとコートスピンナー 部220のスピンナーテーブル221とに合わせて調整 され、他方で乾燥ハンド240の位置はスピンナーテー ブルと乾燥部250の位置100Aに合わせて調整され る。そのため乾燥ハンド240による冷却テーブル27 1へのディスク受け渡し位置と冷却テーブル271から のディスク取り出し位置との間には位置ずれが生じてし 送られる。以上の説明からわかるであろうように、ディ 50 まう。そこでたとえば前後シリンダ274の移動方向

(図9の矢印方向)を上記位置ずれ方向に合わせ、更に 前後シリンダ274によって冷却テーブルの位置を乾燥 ハンド240からのディスク受け取り時とコートハンド 210へのディスク受け渡し時とで変えることにより、 位置ずれを解消することができる。

【0068】冷却仮置きテーブル部270からコートハ ンド210bによりピックアップされたディスクはスピ ンコート部1側の本硬化UV放射部上の位置80Bに移 載される。この位置においてディスクは本硬化UV放射 部80のディスク移動機構85のスピンドル183上に 載置される。

【0069】スピンドル183上に置かれたディスク は、スピンドル183により回転されながらディスク移 動機構85により位置80Bから位置80Aに向かって 移動され、その途中でUV照射ユニットによるUV照射 を受ける。この際、ボールねじユニット180によるデ ィスクの直線移動制御は、樹脂の硬化に必要なUV照射 時間などの諸条件に応じて適宜決められる。たとえば一 定速度でUV照射ユニットの照射領域を移動させてもよ いし、または照射領域内で一旦停止、あるいは速度を低 20 下させて、照射時間を延長するようにしてもよい。

【0070】この本硬化UV照射部80の復路において は、ディスク上に塗膜された光透過層(これは往路にお けるUV照射で半硬化状態にある)およびその上に形成 されたハードコート層をそれぞれ形成する光硬化型樹脂 を完全に硬化する本硬化処理を行う。

【0071】本硬化処理を終えて位置80Aに戻された ディスク100は移載ハンド部30のアーム31℃によ り次の膜厚検査部90に移載される。膜厚検査部はディ スクにコーティングされた光透過樹脂層の膜厚が所定の 30 範囲内にあるかどうかを検査するために、ディスクの光 透過樹脂層の膜厚を測定するものである。移載ハンドの アーム31 Cによりディスク100は膜厚検査部の位置 90Aにおいて移動テーブル91に載置される。移動テ ーブル91は一軸ボールねじユニット93により該ユニ ット93に沿って移動され、膜厚測定器としてのレーザ 一変位計95の直下に移動される。移動テーブル91は その上に載置されたディスクを回転させる機能を有して おり、ディスクの回転とボールねじユニット93による 直線移動とを組み合わせて、レーザー変位計による測定 40 点を変え、1つのディスクに対して複数の測定点におい て膜厚測定を行う。典型的な例では、一つの円周上につ いて各8点の測定を7つの径方向位置について行う。従 って測定点は8×7=56点となる。

【0072】膜厚測定を終えたディスクは移動テーブル に載ったまま再び位置90Aに戻され、その位置におい て移載ハンド部30のアーム31Dによりクリーナー部 20に送られる。但し膜厚検査部90における膜厚検査 の結果、コーティングが適正な膜厚で行われていないこ とが判明した不良ディスクは、膜厚検査部90からクリ 18

ーナ部への移載の途中でアーム31 dによる真空吸着を 解除して、ディスクを不良ディスク排出部110に受け 渡す。

【0073】膜厚検査部90からクリーナー部20の位 置22Bに移載された良品ディスクはターンテーブル2 2の回転により位置22Aへと移動され、そこから供給 ハンド13bによりアンローダー15のピンホルダー1 15上にピン115aがディスクの中心穴にはまりこむ ように載置される。なおアンローダー15側のピンホル ダー115もローダー11側のピンホルダーと同様にリ フター116を備えており、ピンホルダー115にディ スクがスタックされて行くにつれて該リフター116が 下降し、スタックの一番上のディスクの高さが常に一定 となるようにする。所定数の処理済みディスクがアンロ ーダー15のピンホルダー115にスタックされると、 ピンホルダー115を図1の左方向に移動し、装置左端 からスタックされたディスクを装置取り出せるようにす

【0074】以上で本実施形態のスピンコーティング装 置の動作の一つのサイクルが終了する。

【0075】なお以上に説明したスピンコーティング装 置の動作は全てCPUを有する装置の制御部(不図示) の制御の下で自動的に行われる。以上本発明の一実施形 態を説明したが本発明はこの実施形態に限定されるもの ではない。

【0076】以上の実施形態はブルーレーザー対応ディ スクの光透過膜およびハードコート層のスピンコーティ ングに関するものであったが、これに限らず本発明はデ ィスク体上に2層以上の放射線硬化型材料層をコーティ ングする際に広く適用することができる。他の例として はたとえばCD-Rのトップコート層とその上に形成さ れるハードコート層のコーティング等がある。

【0077】また本実施形態においてコーティングされ た樹脂はUV硬化型樹脂であったが、本発明はこれに限 定されず、例えば赤外線硬化型材料その他の光硬化型材 料、電磁波硬化型材料、X線硬化型材料、電子線硬化型 材料あるいは超音波硬化型材料などの様々な放射線硬化 型材料のディスク体へのコーティングに適用することが できる。

[0078] 【実施例】上記実施形態に説明した装置を用いて以下の ようにしてブルーレーザー対応ディスクを作成した。 【0079】ディスク状基体上にアルミニウムからなる 反射膜を成膜したディスクに、スピンナー部40により 紫外線硬化型樹脂(25度Cにおける粘度5000c P) をスピンコートにより塗布し、本硬化UV放射部8 0の往路において140mJ/cm²のUV積算光量を照射して 半硬化させ、98umの光透過層を得た。続いてコートスピ ンナー部220により、光透過層の上にアクリル系ハー ドコート (日本化薬HOD3200) を2umの膜厚でスピンコー

トした。乾燥部250における加熱条件を80度C5分間としてアニールし、冷却後、本硬化UV放射部80の復路においてUV積算光量3000mJ/cm²で光透過層およびハードコート層を硬化させた。

【0080】以上のようにして作成した光ディスクは、各種信頼性試験においてもクラックの発生がなく、またアニールの硬化によりディスクの反り角は、アニールなしのディスクの約半分に低減した。

[0081]

【発明の効果】本発明の光ディスク製造装置では、ディスクに2層の放射線硬化型液状材料をコーティングするに際して単一の放射線照射手段を共通に用いて液状材料の硬化を行うことで装置構成を簡略化することができる。

【0082】また、本発明のディスク製造装置において、第1のコーティング後にディスクに放射線を照射して第1の層の放射線硬化型樹脂材料を半硬化させ、その後第2の放射線硬化型液状材料をコーティングして第2の層を形成し、その後、放射線照射手段によりディスクに放射線を照射して第1の層および第2の層を完全に硬20化させることにより、第1の層を完全に硬化させてから第2層をコーティングする場合に比べて処理時間を短縮することができる。また半硬化状態で次の層をコーティングし、その後に両層を完全に硬化させることにより両層間の界面形成によるクラックの発生が低減される。

【0083】また本発明の光ディスク製造方法では、少なくとも2層の放射線硬化型樹脂層を積層する工程を含む光ディスクの製造方法において、一つの樹脂層を積層した後に該樹脂層を硬化させる作用を持つ放射線を照射し、該樹脂層が半硬化の状態で照射をやめて次の層を積層するという工程を繰り返し、最後の層を積層した後に放射線を照射して全ての層を完全硬化させている。このように各層を完全に硬化させずに半硬化状態で次の層を積層することで処理時間を短縮することができる。また層間の界面形成によるクラックの発生が低減される。

【0084】また本発明の別の態様としての物品処理システムでは、一つの処理装置上の物品の位置を一方向で前後移動可能とすることにより、2つの物品移載ハンドの位置ずれを補償して、移載ハンドによる物品のピックアップを正確に行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態としてのコーティング装置の 全体構成を示す平面図である。

【図2】コーティング装置の本UV硬化部の概要を示す 側面図である。

【図3】コーティング装置の本UV硬化部の要部の構造を示す側面図であり、図2に対して90度をなす別の方向から見た図である。

【図4】コーティング装置のハードコート部のディスペンサーを示す側面図である。

20 【図 5】コーティング装置の乾燥部の概要を説明する側 面図である。

【図6】乾燥部において回転テーブル上にディスクが載 置される様子を示す側面図である。

【図7】コーティング装置の冷却仮置きテーブル部の冷却テーブルとその上に置かれたディスクを示す平面図である。

【図8】冷却仮置きテーブル部の側面図である。

【図9】冷却仮置きテーブル部の装置ベースプレートへ 10 の取り付けの様子を示す平面図である。

【符号の説明】

- 1 スピンコート部
- 2 ハードコート部
- 10 ロード・アンロード部
- 11 ローダー
- 13 供給ハンド
- 15 アンローダー
- 20 クリーナ部
- 22 ターンテーブル
- 20 24 クリーナー
 - 30 移載ハンド部
 - 31 移載ハンド
 - 40 スピンナー部
 - 50 マスク供給排出部
 - 51 マスク移動アーム
 - 55 マスクストレージ
 - **、56 マスク**
 - 60 エッジクリーニング部
 - 61 エッジクリーナ
- 30 65 ナイフエッジ
 - 70 仮硬化UV放射部
 - 7 1 本体部
 - 72 照射ヘッド部
 - 80 本硬化UV放射部
 - 81 UV照射ユニット
 - 85 ディスク移動機構
 - 90 膜厚検査部
 - 100 ディスク
 - 110 不良ディスク排出部
- 40 210 コートハンド
 - 220 コートスピンナー部
 - 221 スピンナーテーブル
 - 230 ディスペンサー部
 - 231 ディスペンサーアーム
 - 233 ハードコート液塗布ノズル
 - 235 除電クリーナーノズル
 - 237 除電装置
 - 240 乾燥ハンド
 - 250 乾燥部
- 50 251 乾燥テーブル

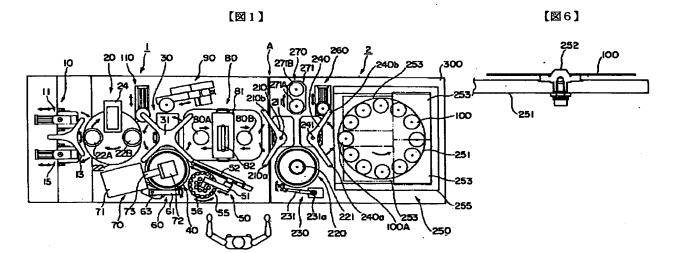
253 赤外線パネルヒーター260 ディスクストック部

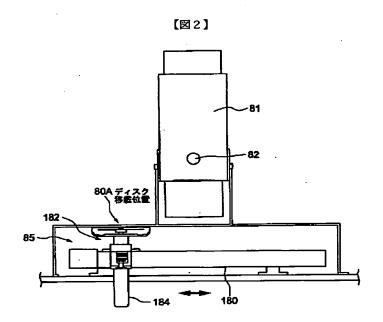
270 冷却仮置きテーブル部

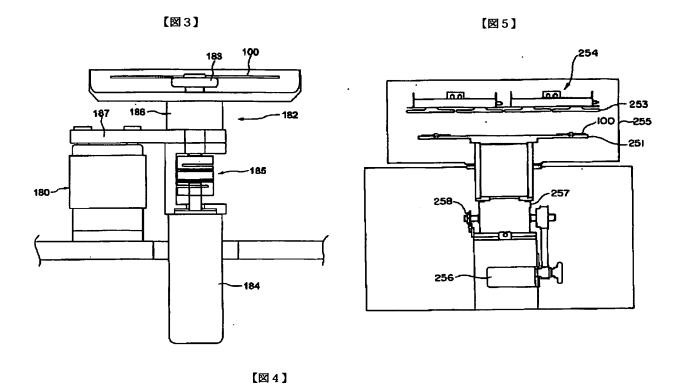
271 冷却テーブル

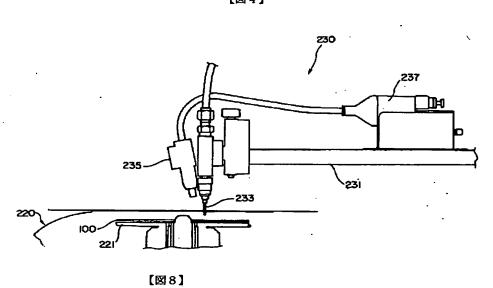
273 前後シリンダ

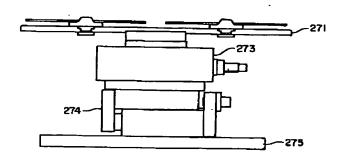
275 固定プレート



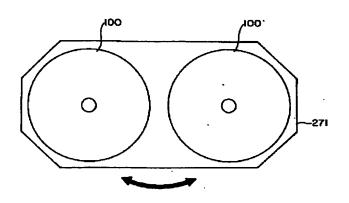




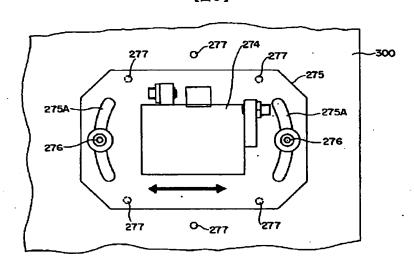




[図7]



【図9】



フロントページの続き

(72) 発明者 宇佐美 守

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ

ーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 小巻 壮

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内

(72) 発明者 林田 直樹

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティ ーディーケイ株式会社内

Fターム(参考) 5D029 LB13

5D121 AA04 EE22 EE24 EE27 EE28 GG02 GG07 GG20 GG28 JJ02 JJ03 JJ04 JJ07 JJ08 JJ09

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.